

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第1区分
 【発行日】平成18年7月20日(2006.7.20)

【公開番号】特開2005-200226(P2005-200226A)
 【公開日】平成17年7月28日(2005.7.28)
 【年通号数】公開・登録公報2005-029
 【出願番号】特願2004-5216(P2004-5216)
 【国際特許分類】

C 0 4 B 35/00 (2006.01)

C 0 4 B 41/89 (2006.01)

F 0 1 D 5/28 (2006.01)

F 0 2 C 7/00 (2006.01)

【F I】

C 0 4 B 35/00 Z

C 0 4 B 41/89 A

F 0 1 D 5/28

F 0 2 C 7/00 C

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月1日(2006.6.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0043】

また、ハフニアからなる第2層は、耐環境性皮膜材料の説明において述べたとおり、実質的に不純物を含まない100%のハフニアで形成しても良いが、製造過程で必然的に含まれる不純物あるいは意図的に添加される成分を含んだものでも良く、例えばジルコニア(ZrO_2)を含む(100%を除く)ものであることが原材料の入手の容易性や製造コストの点において好ましい。市販のハフニアの場合、ジルコニアを不純物として必ず含むため、希土類酸化物及びシリカよりなる群から選ばれた1つまたは2つ以上によって立方晶系或いは正方晶系の高温安定相として安定化することが好ましい。中でも、基材として窒化珪素や炭化珪素などのシリコンを含むセラミック基材の耐減肉性を上げるための皮膜として用いる場合には、仮に基材が酸化してシリカを生成してもそのシリカを吸収して安定なハフノンあるいはジルコンを形成されることが望ましく、基材に近い部分では安定化剤としてシリカを使用することが好ましい。